



(Taiwan)

EVG Releases Automated Photoresist Process System – December 6, 2022

EVG發表自動化光阻製程系統

2022-12-07

EV Group (EVG) 宣布發表次世代200毫米版本的EVG150自動化光阻製程系統，強化該公司的光學微影解決方案產品組合。重新設計的EVG150平台包括先進功能與強化項目，與前一代平台相比可提供更高的製程產出(最多高出80%)、通用性，以及更小的設備佔地面積(減少近50%)。EVG150在通用的平台上提供可靠且高品質的塗布與顯影製程，可支援各種裝置與應用，包括先進封裝、微機電系統、無線射頻(RF)、3D感測、功率元件以及光子元件。EVG150極高的製程產出、彈性與再現性，能支援大規模量產與工業開發所需的最嚴苛需求。

電子控制系統(EBS)產業的頂尖研究中心Silicon Austria Labs是第一個採用次世代EVG150系統的客戶。

Silicon Austria Labs微系統研究部門負責人Mohssen Moridi博士表示，早在工業4.0、物聯網、自動駕駛、虛實整合系統(CPS)、人工智慧、智慧城市、智慧能源與智慧醫療問市前，Silicon Austria Labs就透過與引領業界的製造商共同研究，開發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG的次世代EVG150光阻製程系統的高度彈性，為Silicon Austria Labs客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎，並推動EBS的創新。

為200毫米基板設計的次世代EVG150保有前一代平台引領業界的功能，包括具有全自動化功能的可客製化的旋轉與噴霧式塗佈、顯影、烘烤與冷卻模組；EVG專有的OmniSpray技術，可因應極端形貌的成形塗佈；精密且經現場驗證的機械化處理，具雙末端執行器可確保持續的高製程產出；以及晶圓邊緣、弓形、翹曲及薄化晶圓的處理。

<https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/news/5AAEFDE3323A4FC3A7570EB7BC824AE8>